

半導体ペンチャー2008

石室 祝氏

クス 役
メック 締
ナ取 務
カ務 専

「装置も風邪をひく。迅速かつ細やかなアフターフォローが必要だ」と愛情を込めて語るのは、半導体製造装置製造歴三年の(株)ナメック



る。後工程にも本格的に進出し始めた。石室氏が自社のことを「小さな

顧客の現場へ足を運び、顧客の声に熱心に耳を傾ける姿には、社内外から絶大な信頼が集まる。日本半導体がDRAMで世界を席巻し、世界の中心で日本旋風を巻き起こ

「百貨店」と自称するようになり、同社の手がける装置は多彩だ。たとえば、浸漬パッチプロセスから枚葉式のスピンプロセス装置の設計・製作、半導体用フォトマスクの洗浄・

&D関連。また、ディップが三割に対し、枚葉が七割を占める。新規プロセス技術を顧客とともに手がけるケースが多く、市場の先読みができる利点がある。これまで、パッチ浸漬方式から枚葉スピン方式まで広範囲の処理技術を経験してきたこと

一方、デモ・評価装置にも定評がある。現像、エッチング、剥離、洗浄、塗布の全工程でのデモ・評価が可能な体制を構築しており、特に枚葉案件

技術では、浸漬回転揺動方式を用いている。薄型ウエハー裏面などへのレジストコート技術では、表面への塗布だけでなく、ウエハー裏面、ペリフェラル領域、スプレーによるコンフォーマル塗布など様々なニーズに注力する。

も、昨今の電子デバイス多様化に伴い、洗浄、塗布、現像、エッチング、剥離などプロセス処理の多様化(超大型化、立体構造化、極薄化)に迅速に対応していく必要がある。そのためには、装置メーカーであるとともに、プロセス開発サポ

「新規プロセス技術の開発志向は今後も貫いていく。その先に、サードパーティーとのパートナーシップや、海外メーカーとのタイアップ、海外市場への参入などの好機があれば、既存のお客様サポートとの兼ね合いを見ながら検討していきたい。一方で、ソフト関連をすべて自社で手がける現体制はフレキシブルな顧客サポートを実現する上で必要不可欠。ソフト

装置業界の小さな百貨店

していた一九八五年六月に創業した同社。当初、フォトマスクの洗浄装置などに特化し起業。ウエハーのフォトプロセスはもちろんのこと、最近では、液晶用フォトマスク分野、電子デバイスの進化に伴うウエハー研磨分野、ウエハーバンピングやWLPなどのウエハーレベルでのフォトプロセス分野にも精通してい

現像・エッチング、最先端の液晶用フォトマスク、有機EL基板洗浄機、洗浄・塗布・現像・エッチング・剥離など各種ウエハープロセス、CMP・BGなど各種研磨後の洗浄など、前工程から後工程まで幅広いラインアップを誇る。最近では、太陽電池関連装置の試作機なども開発中だという。

体、ブラシ、高圧純水を用いたシングルチャンバ、マルチチャンバーなどの標準型をベースとし、各種オプションと組み合わせることで装置価値を高めてきた。たとえば、機能水搭載型エンジンストド洗浄、大気圧プラズマやエキシマUV搭載型エンジンストド洗浄など

「マスクの次世代市場ニーズへの対応など、すべての分野で技術課題は尽きない。その中で、当社はウエット処理技術をさらに進化させることが他社との差別化点だと自負している。そのために

専務自ら現場訪問 顧客の声重視

「顧客エンジニアのニーズは永遠で無限である」という経験が何よりも事業活動の源になっている」と語る石室専務。今日も顧客の製造現場を訪問し、熱心に耳を傾ける石室氏がいる。

「当社案件の七割はR

また、エッチング処理

「今後の経営方針について

「今後の経営方針について

(高澤里美記者)